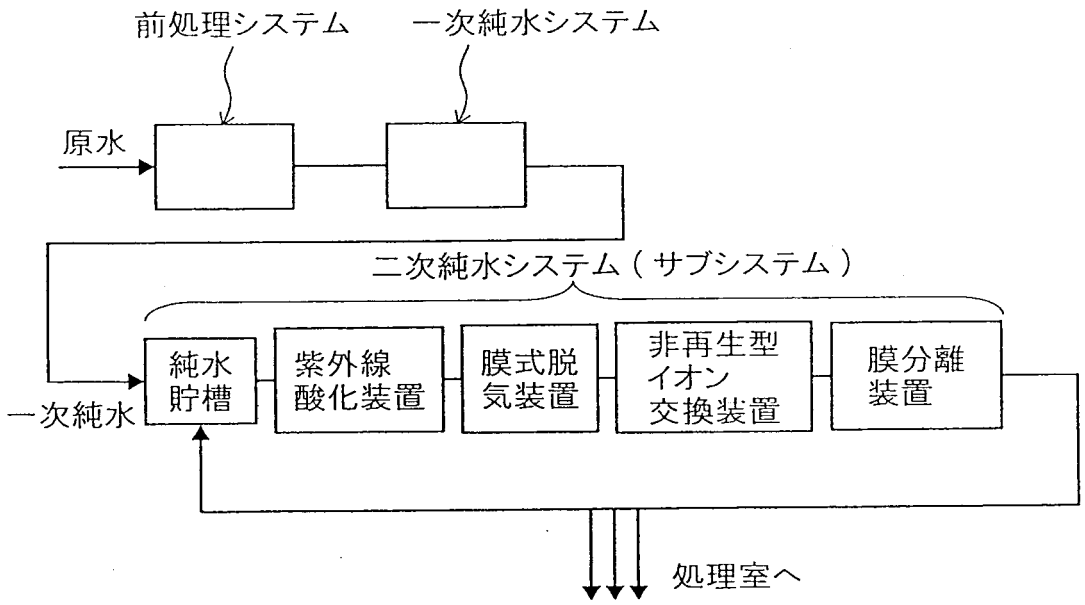
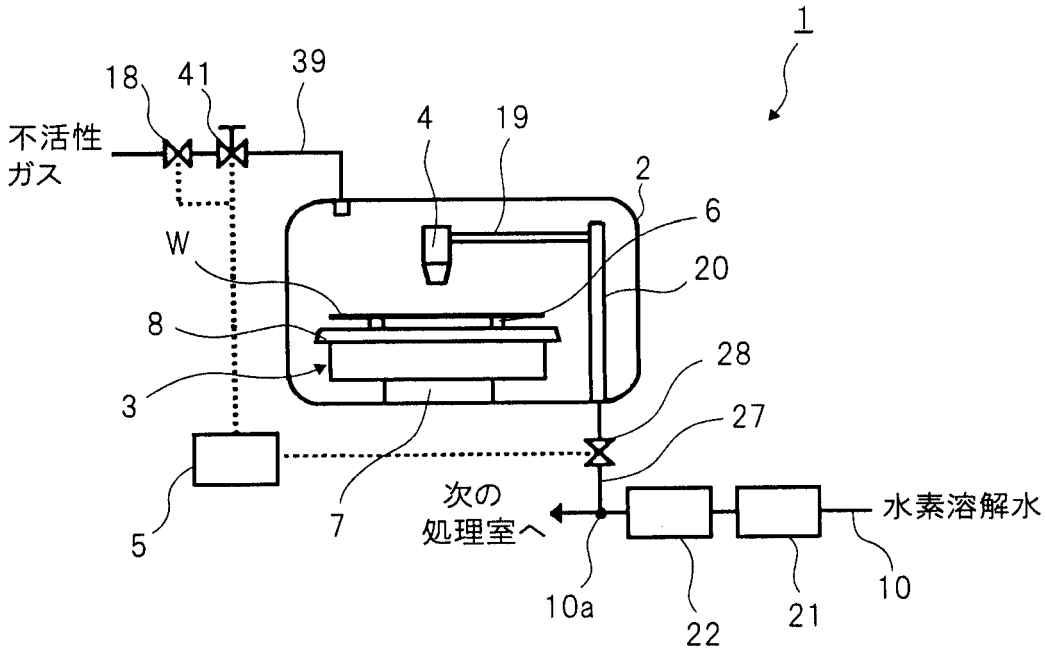
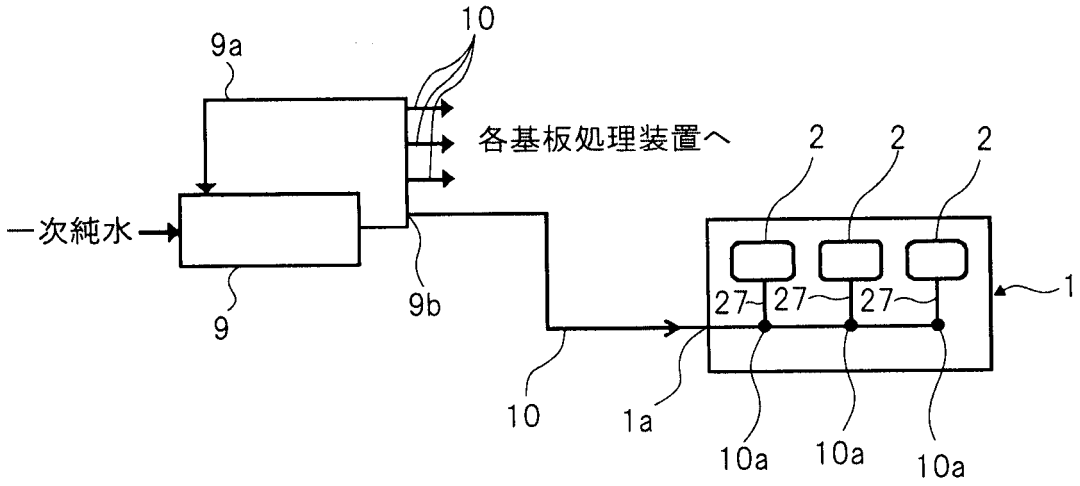
[図1]


前処理システム
一次純水システム
原水
二次純水システム（サブシステム）
純水貯槽
紫外線酸化装置
膜式脱気装置
非再生型イオン交換装置
膜分離装置
一次純水
処理室へ

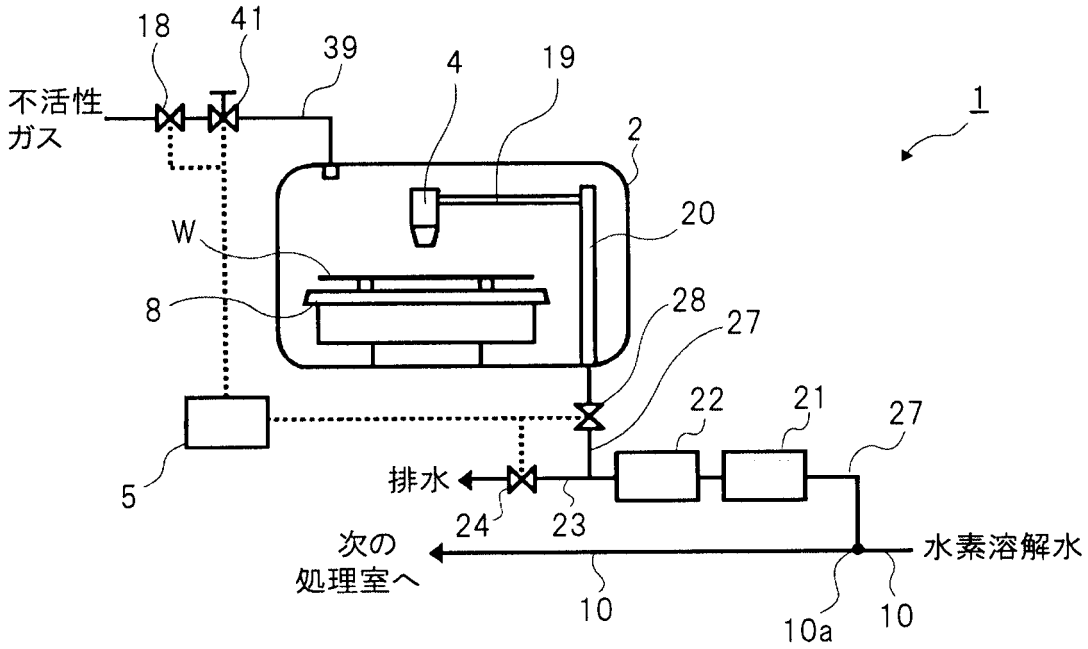
[図2]


1
18
41
39
不活性ガス
4
19
2
6
W
20
8
28
3
27
次の処理室へ
水素溶解水
5
7
10a
22
21
10

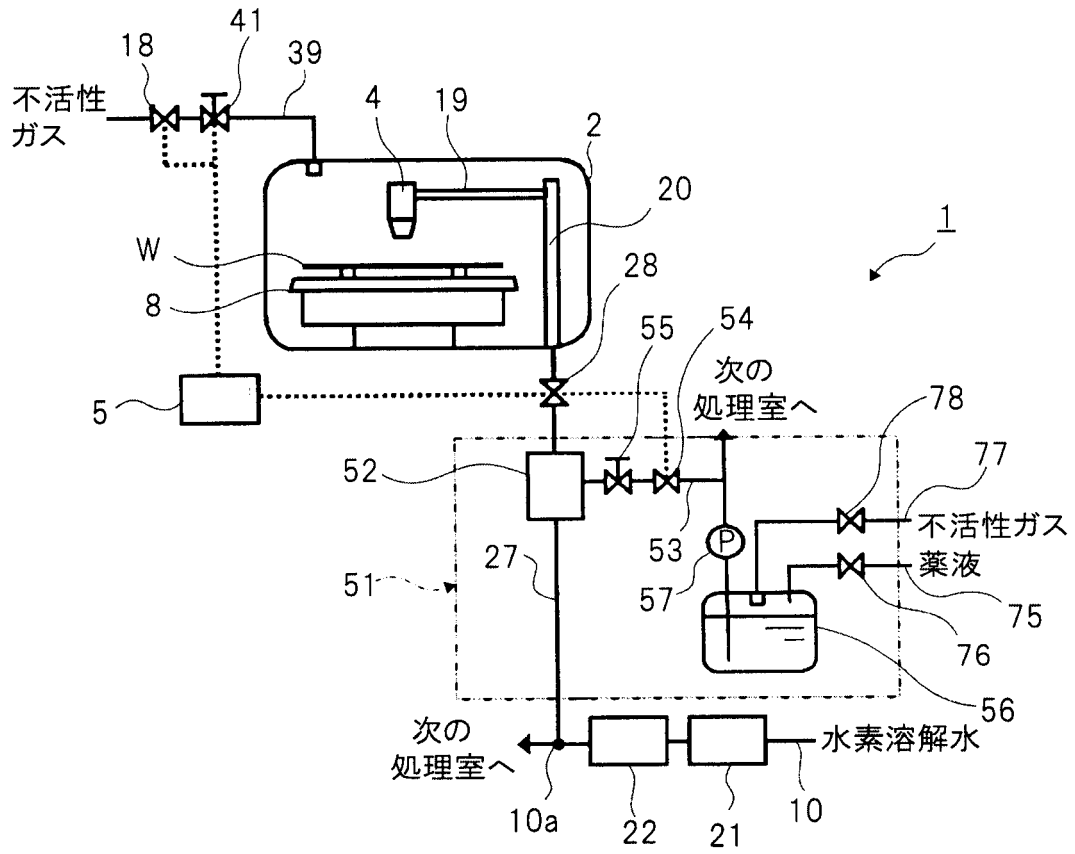
[図3]


10
9a
各基板処理装置へ
2
2
2
一次純水
9
9b
27
27
27
1
10
1a
10a
10a
10a

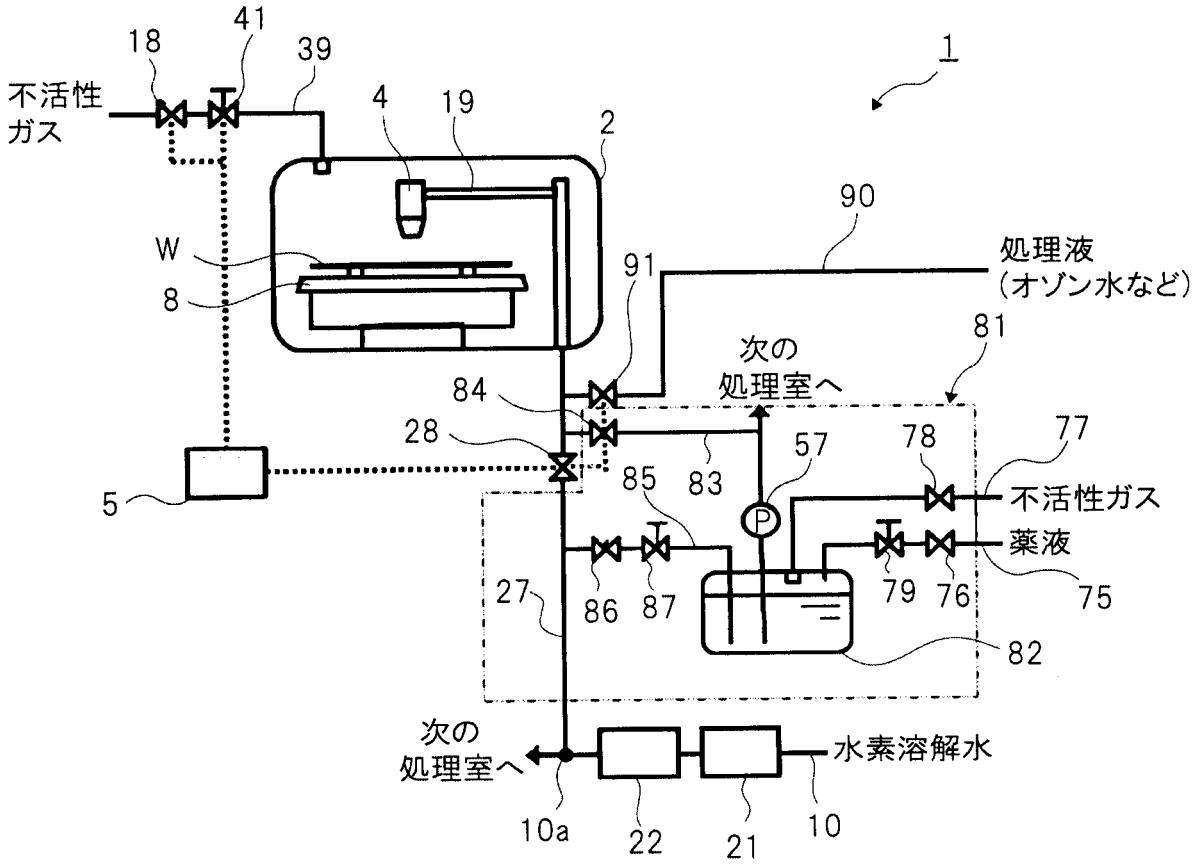
[図4]


18
41
39
4
19
1
不活性
ガス
2
20
W
8
28
27
22
21
27
5
排水
24
23
次の
処理室へ
水素溶解水
10
10a
10

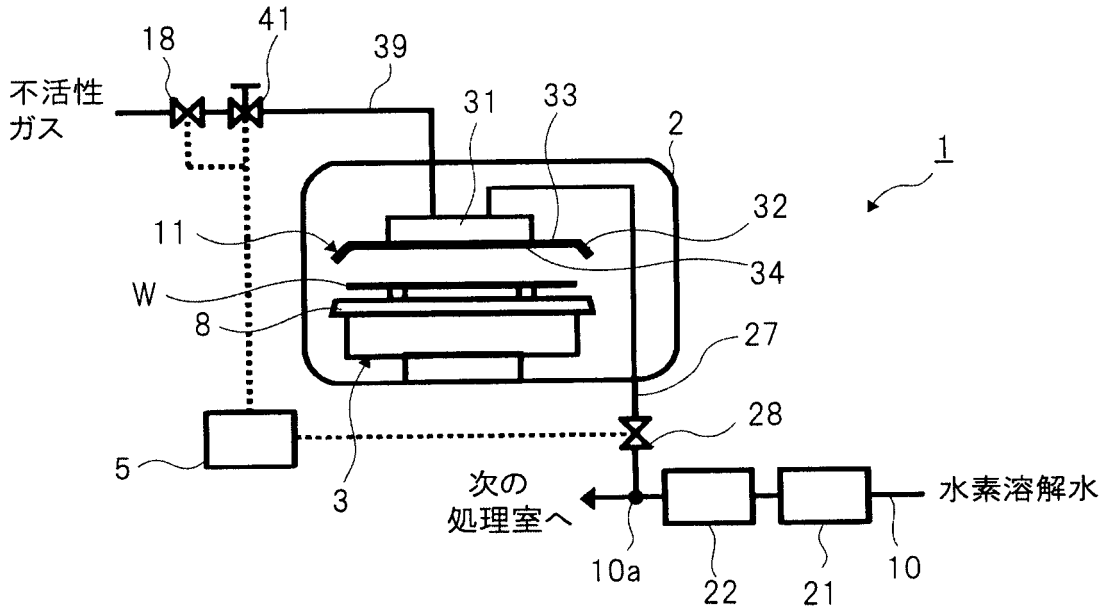
[図5]


18
41
39
不活性
ガス
4
19
2
20
1
W
8
28
55
54
次の
処理室へ
78
5
52
77
不活性ガス
薬液
53
27
51
57
P
75
76
56
次の
処理室へ
水素溶解水
10a
22
21
10

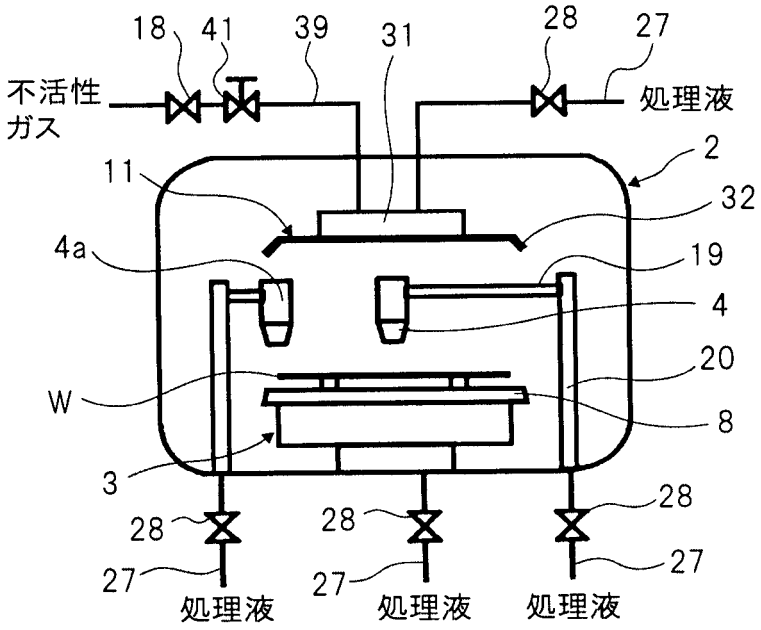
[図6]


18
41
39
不活性
ガス
4
19
2
1
90
処理液
(オゾン水など)
W
8
91
81
次の
処理室へ
84
28
57
78
77
85
83
不活性ガス
薬液
5
27
86
87
79
76
75
82
次の
処理室へ
水素溶解水
10a
22
21
10

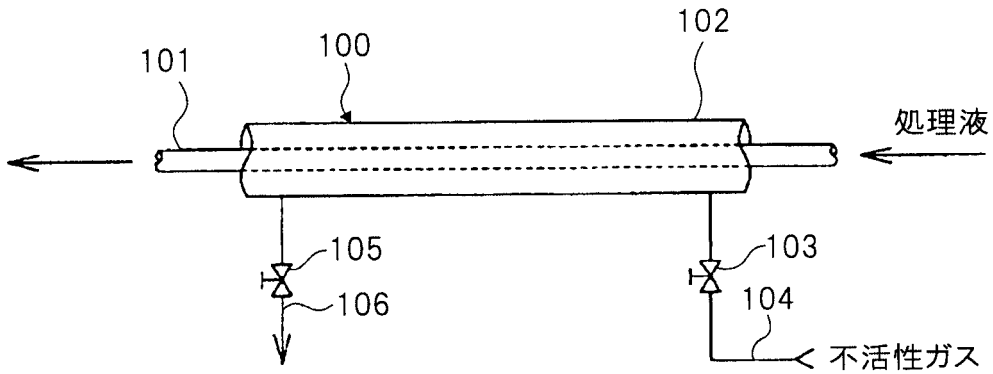
[図7]


18
41
39
不活性
ガス
31
33
2
1
32
11
34
W
8
27
28
5
3
次の
処理室へ
水素溶解水
10a
22
21
10

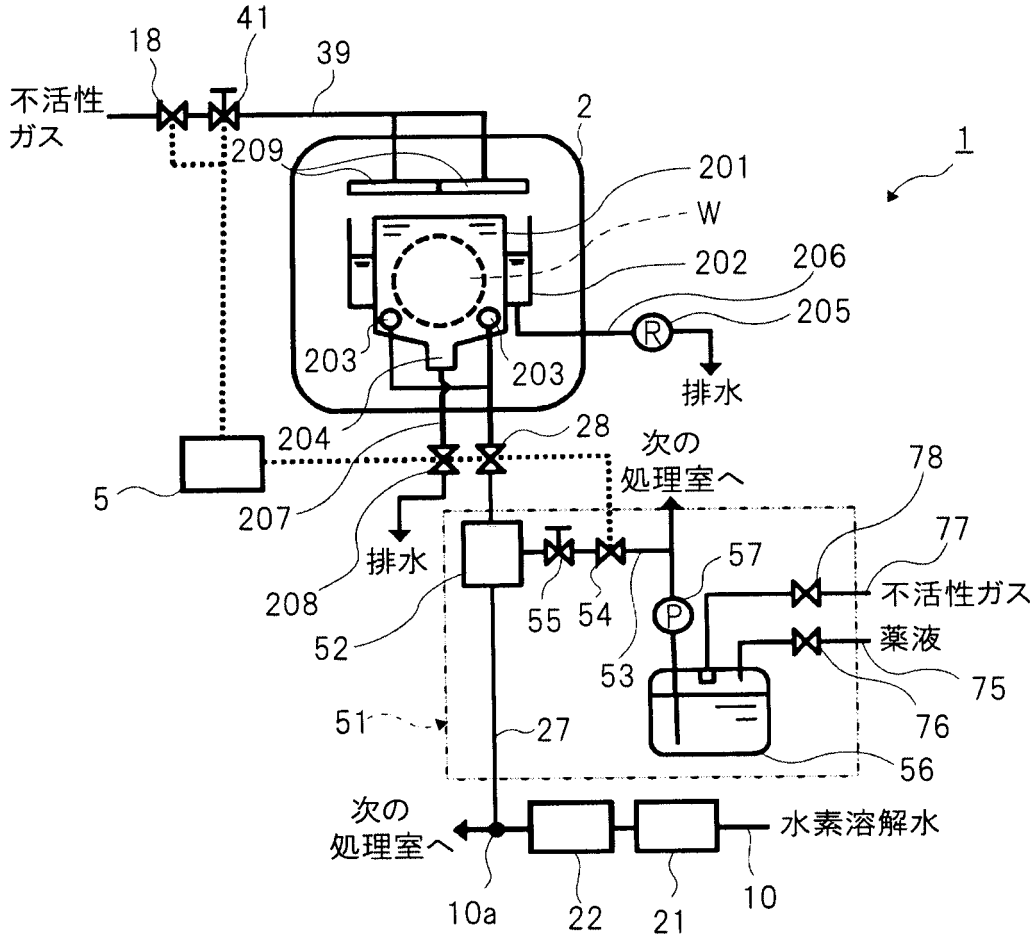
[図8]


18
41
39
31
28
27
不活性
ガス
処理液
2
11
32
4a
19
4
20
W
8
3
28
28
28
27
27
27
処理液
処理液
処理液

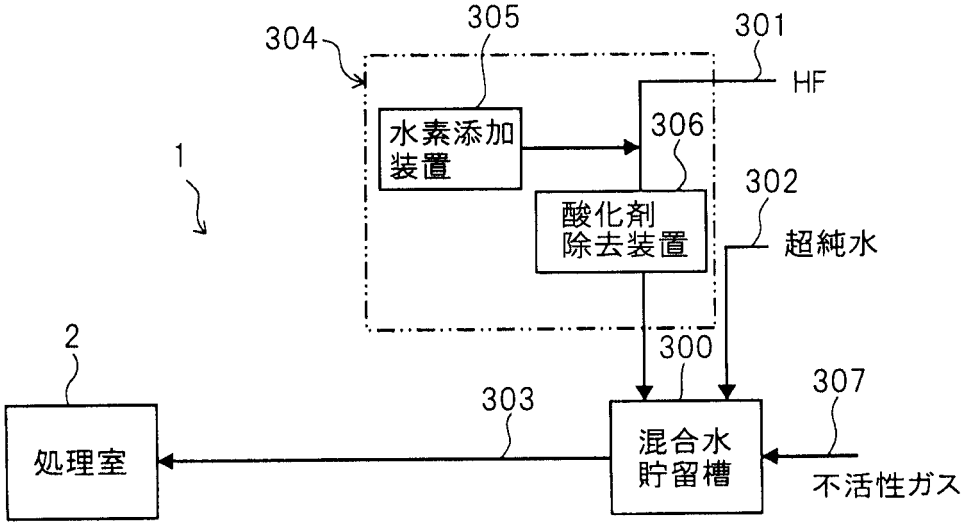
[図9]


101
100
102
処理液
105
106
103
104
不活性ガス

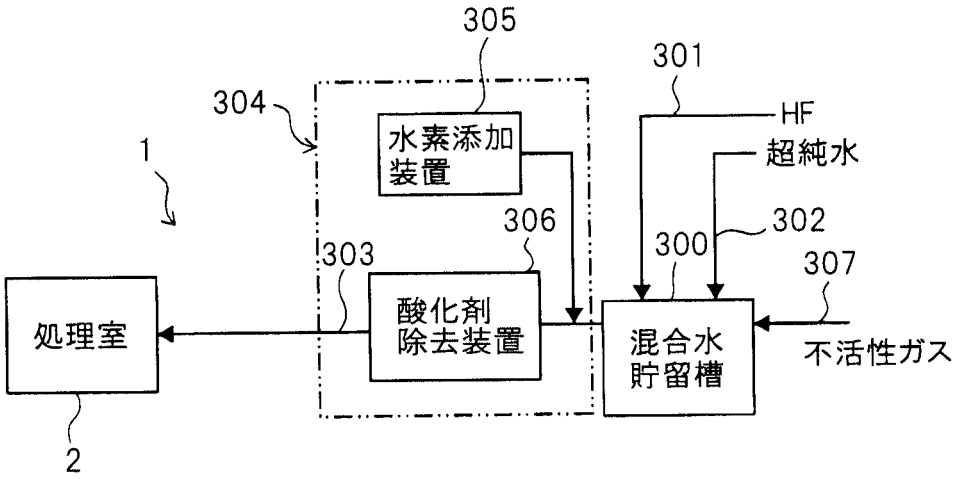
[図10]


41
18
39
不活性
ガス
2
209
201
1
W
202
206
205
R
203
203
排水
204
28
次の
処理室へ
78
5
207
77
排水
57
208
不活性ガス
55
54
P
52
薬液
53
75
51
27
76
56
次の
処理室へ
水素溶解水
10a
22
21
10

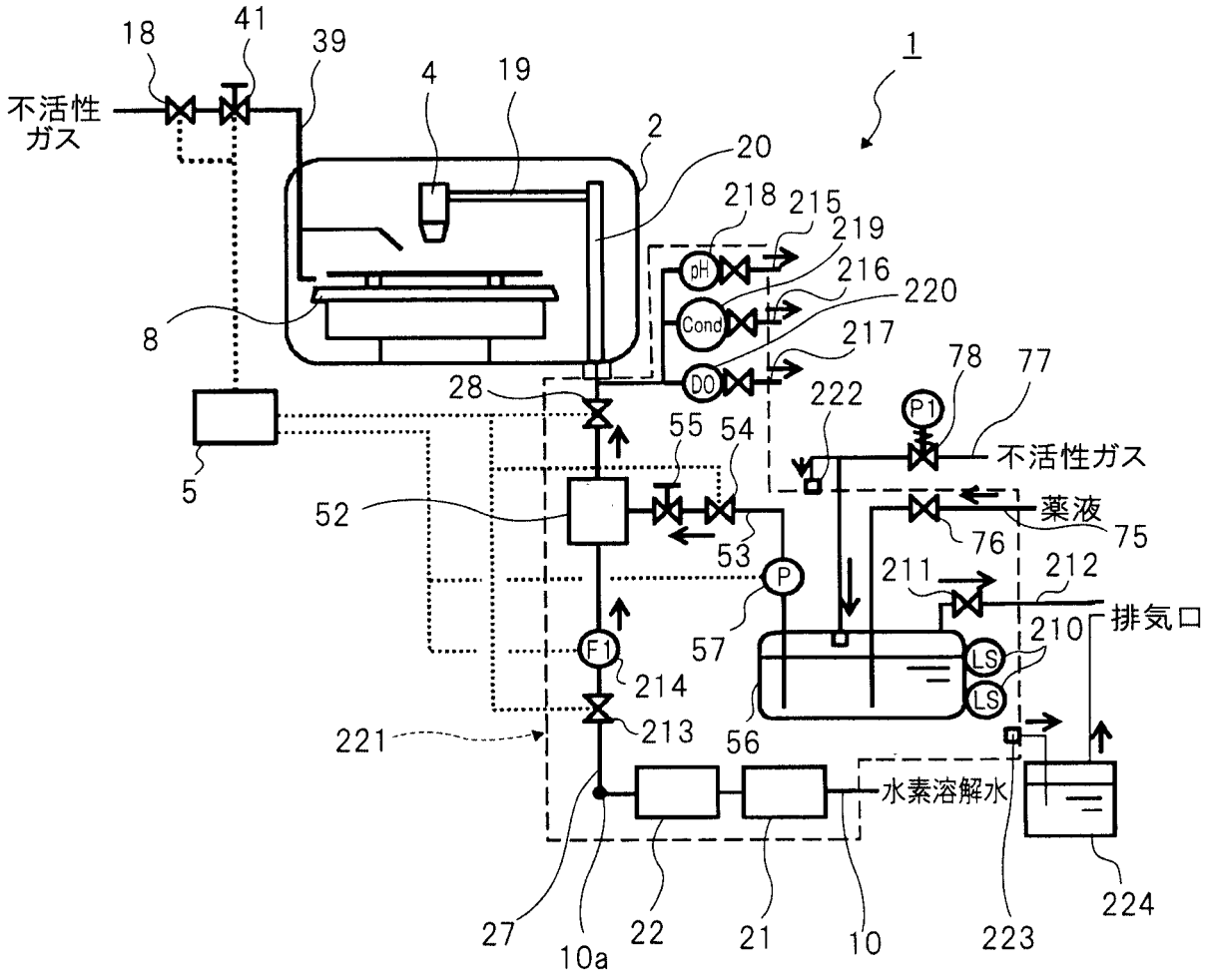
[図11]


304
305
301
HF
水素添加
装置
306
1
302
酸化剤
除去装置
超純水
2
300
307
303
混合水
貯留槽
処理室
不活性ガス

[図12]


305
301
304
HF
水素添加装置
超純水
1
306
302
303
300
307
処理室
酸化剤除去装置
混合水貯留槽
不活性ガス
2

[図13]


18
41
39
4
19
1
不活性ガス
2
20
218
215
219
pH
216
220
Cond
8
217
DO
78
77
28
222
P1
55
54
不活性ガス
5
52
薬液
76
75
53
P
211
212
排気口
57
210
F1
LS
214
LS
221
213
56
水素溶解水
27
10a
22
21
10
223
224